

ной деформации. Однако, несмотря на это различие, при некоторых условиях (например, когда примесь находится в довольно диспергированном состоянии) изменения σ_y и H при легировании могут определяться одними и теми же основными факторами, тогда между этими изменениями существует хорошая корреляция. Таким фактором может служить, например, подвижность дислокаций. Действительно, в NaCl:Ca имеется хорошее согласие между изменениями предела текучести, микротвердости и подвижности дислокаций [3,4]. Довольно неожиданным является тот факт, что в некоторых случаях (деформирование при 400 °C) поведение микротвердости лучше коррелирует с поведением предела текучести, чем деформирующего напряжения при $\varepsilon \sim 10\%$.

Список литературы

- [1] Chin G.I., van Uitert L.G., Green M.L., Zydsik G. Scr. Metal. 6, 6, 475 (1972).
- [2] Боярская Ю.С., Житару Р.П., Кац М.С., Линте М.А., Шутова С.С. ФХОМ, 6, 75 (1981).
- [3] Boyarskaya Yu.S., Zhitaru R.P., Linte M.A. Cryst. Res. Techn. 19, 1, 101 (1984).
- [4] Боярская Ю.С., Грабко Д.З., Кац М.С. Физика процессов микроиндентирования. Кишинев (1986). С. 294.
- [5] Васаускас С.С. В кн.: Исследования в области измерения твердости. М.-Л. (1967). С. 33.
- [6] Боярская Ю.С., Житару Р.П., Палистрант Н.А. Письма в ЖТФ 19, 14, 60 (1993).
- [7] Андреев Г.А., Клинов В.А. ФТТ 22, 11, 3481 (1980).
- [8] Боярская Ю.С., Житару Р.П., Палистрант Н.А. ФТТ 37, 2, 382 (1995).

Физика твердого тела, том 38, № 3, 1996
Solid State Physics, vol. 38, N 3, 1996

ЭФФЕКТ РАЗУПРОЧНЕНИЯ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ НА ОСНОВЕ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ ФАЗ

© Е.И.Рогачева

Харьковский государственный политехнический университет,
31000 Харьков, Украина

(Поступило в Редакцию 20 июня 1995 г.

В окончательной редакции 25 октября 1995 г.)

Хорошо известен эффект упрочнения в твердых растворах, наблюдаемый при введении примесей в металлические и полупроводниковые кристаллы и сопровождающий увеличением таких механических характеристик, как предел текучести, микротвердость и т.д. С точки зрения дислокационных теорий основной причиной упрочнения является упругое взаимодействие дислокаций с примесными атомами (ПА), приводящее к торможению либо уменьшению скорости движения дислокаций [1,2]. Наблюдаемые случаи разупрочнения некоторых полупроводниковых кристаллов (Ge, Si, соединений типа A^3B^5) при введении в них малых количеств (до ~ 0.1 at.%) электрически активных ПА

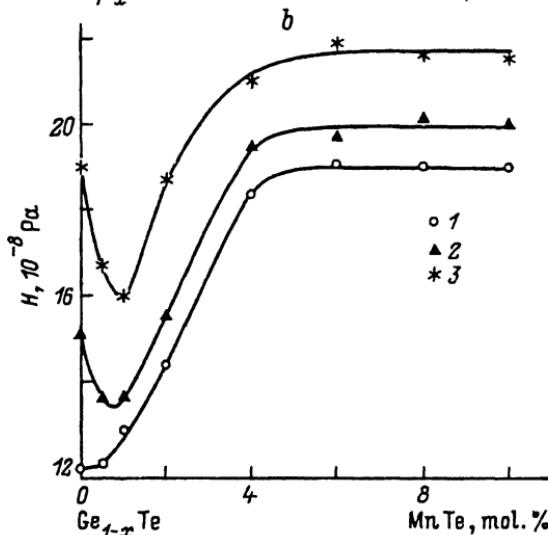
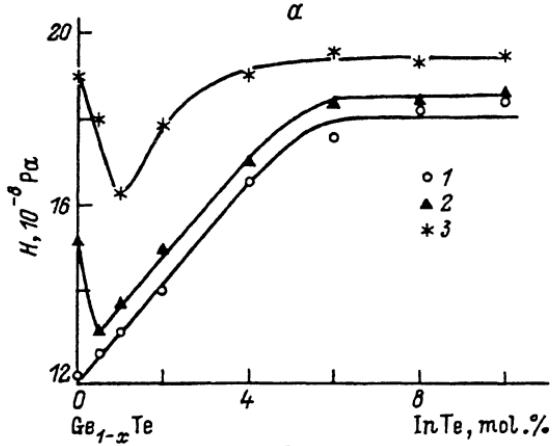
связывались с доминирующим вкладом электронного фактора (изменение положения уровня Ферми при легировании, взаимодействие заряженных дислокаций с ионами примеси и т.д.), приводящего к снижению барьеров Пайерлса, увеличению вероятности двойных перегибов и соответственно увеличению подвижности дислокаций [1–4]. Термодинамически равновесное отклонение от стехиометрии, имеющее место в любом полупроводниковом соединении при $T \neq 0$, приводит к появлению в нем дефектов нестехиометрии (ДН). Наличие последних может определить еще один механизм разупрочнения, обусловленный компенсирующим действием примесных и собственных дефектов в поле движения дислокаций. Цель настоящей работы — подтверждение возможности реализации указанного механизма разупрочнения.

В качестве модельного объекта выбрано полупроводниковое соединение Ge_{1-x}Te , обладающее широкой областью гомогенности, расположенной со стороны избытка Te относительно стехиометрического состава (при $T = 520$ К $x = 0.008\text{--}0.036$). Основным типом ДН являются катионные вакансии, концентрация которых определяется параметром x [5]. В задачу работы входило исследование зависимости микротвердости H от содержания In (донарная примесь) и Mn (нейтральная примесь), вводимых путем катионного замещения в Ge_{1-x}Te со значениями x , равными 0.008, 0.024 и 0.032. Величину H измеряли на поликристаллических образцах, полученных путем сплавления высокочистых элементов в откаченных до 10^{-3} Па кварцевых ампулах и отожженных при 820 К в течение 200 h. Микротвердость H каждого образца определяли при нагрузке 0.49 N путем статистического усреднения результатов измерения 50 отпечатков с точностью не менее 2%.

Из рисунка видно, что при $x = 0.024$ и 0.032 имеет место отчетливо выраженный эффект разупрочнения кристалла: введение примесей до 0.5–10 mol.% приводит к падению H на 10–15%. При дальнейшем увеличении содержания легирующего компонента примеси оказывают упрочняющее действие, характерное для большинства твердых растворов. При введении примесей в Ge_{1-x}Te с минимальной концентрацией ДН ($x = 0.008$) эффект разупрочнения отсутствует, но до ~ 0.5 mol.% примеси H не изменяется.

Тот факт, что характер изменения H практически одинаков для электрически активной и нейтральной примесей, свидетельствует о том, что роль электронной подсистемы в наблюдаемом эффекте разупрочнения незначительна и основной вклад вносит упругое взаимодействие дислокаций, ПА и ДН. Энергия упругого взаимодействия дислокации с ПА пропорциональна фактору размерного несоответствия $u_0 = (r - r_0)/r_0$, где r_0 и r — кристаллохимические радиусы атомов матрицы и легирующего элемента [1,2]. Замещение атомов Ge атомами In и Mn, имеющими больший радиус, чем Ge (ионные радиусы Ge^{2+} , In^{+3} и Mn^{+2} равны соответственно 0.65, 0.91 и 0.9 Å [6]), приводит к расширению решетки и появлению напряжений сжатия вблизи ПА. Катионные вакансии вызывают сжатие решетки Ge_{1-x}Te и увеличение H [5,7]; проведенная нами оценка радиуса вакансии ($r_v = 0.4$ Å) [7] показывает, что вблизи вакансии появляются напряжения растяжения.

Из полученных данных следует, что, хотя и вакансии, и ПА являются местами закрепления дислокаций, их одновременное присутствие



Зависимость микротвердости Ge_{1-x}Te от содержания InTe (а) и MnTe (б).
 x : 1 — 0.008, 2 — 0.024, 3 — 0.032.

вызывает увеличение подвижности дислокаций. Маловероятно, что наблюдаемый эффект связан с уменьшением общего числа стопоров за счет частичного заполнения вакансий атомами примеси, которое имеет место, поскольку добавки InTe и MnTe , вводимые в нестехиометрический Ge_{1-x}Te , являются стехиометрическими. Относительная доля ПА, заполняющих вакансию, слишком мала (не более 1–2%), чтобы такой механизм был ответственен за разупрочнение кристалла. Можно предположить, что разупрочнение является результатом частичной компенсации дальнодействующих упругих полей противоположного знака, создаваемых ПА и вакансиями, приводящей к увеличению скорости движения дислокаций и падению H . Поскольку фактор размерного несоответствия в случае In и Mn практически одинаков, скорости изменения H отличаются незначительно. Определенную роль в реализации данного эффекта должен играть характер деформации, вызываемой ПА и ДН. Если оба типа дефектов вызывают деформацию одного знака, разупрочнение, очевидно, наблюдалось бы не будет. Тот

факт, что эффект разупрочнения в Sn_{1-x}Te , имеющем высокую концентрацию ДН (cationных вакансий), не имеет места при замещении Sn катионами с меньшими, чем у Sn, ионными радиусами [8], является весомым аргументом в пользу предлагаемого механизма.

Обнаруженный эффект имеет, по-видимому, общий характер, наиболее отчетливо проявляясь в соединениях с высокой концентрацией ДН.

Список литературы

- [1] Судзуки Т., Есинага Х., Такеути С. Динамика дислокаций и пластичность. М. (1989). 294 с.
- [2] Хаазен П. Физическое металловедение. М. (1987). Т. 3. С. 187–254.
- [3] Patel J.R., Claudhuri A.R. Phys. Rev. **143**, 2, 601 (1966).
- [4] Вальковская М.И., Пушкаш Б.М., Марончук Э.Е. Пластичность и хрупкость полупроводниковых материалов при испытаниях на микротвердость. Кишинев (1984). 107 с.
- [5] Коржуев М.А. Теллурид германия и его физические свойства. М. (1986). 103 с.
- [6] Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М. (1971). 400 с.
- [7] Рогачева Е.И., Горне Г.В., Весене Т.Б. Изв. АН СССР. Неорган. материалы. **21**, 6, 925 (1985).
- [8] Рогачева Е.И. Изв. АН СССР. Неорган. материалы. **25**, 5, 754 (1989).